

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成23年5月12日(2011.5.12)

【公開番号】特開2008-285402(P2008-285402A)

【公開日】平成20年11月27日(2008.11.27)

【年通号数】公開・登録公報2008-047

【出願番号】特願2008-128370(P2008-128370)

【国際特許分類】

C 03 B	7/094	(2006.01)
C 03 B	7/088	(2006.01)
C 03 B	7/096	(2006.01)
C 03 C	3/089	(2006.01)
C 03 C	3/091	(2006.01)
G 02 F	1/1333	(2006.01)

【F I】

C 03 B	7/094
C 03 B	7/088
C 03 B	7/096
C 03 C	3/089
C 03 C	3/091
G 02 F	1/1333 5 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成23年3月30日(2011.3.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

溶融塊の温度が処理期間中1760を越えているプロセスであって、

破片材料あるいは原材料を溶融して溶融塊とする工程、

前記溶融塊を精製する工程、及び

前記溶融塊をイリジウムあるいはイリジウムを少なくとも50重量%含むイリジウム合金から成る抜取管(4)を通して不連続的なプロセスで注ぎ出す工程から成る前記処理によって高融点ガラス材料、ガラスセラミック材料、あるいはセラミック材料を製造する方法であって、

酸素を含む周辺雰囲気と接触している前記抜取管(4)の一部分の温度が、前記抜取管から溶融塊を注ぎ出す期間中を除き、常に1000未満になるように制御あるいは調節されることを特徴とする前記方法。